

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第2区分

【発行日】平成26年1月23日(2014.1.23)

【公表番号】特表2011-500525(P2011-500525A)

【公表日】平成23年1月6日(2011.1.6)

【年通号数】公開・登録公報2011-001

【出願番号】特願2010-528357(P2010-528357)

【国際特許分類】

| | |
|---------------|-----------|
| C 07 C 381/12 | (2006.01) |
| C 07 F 5/02 | (2006.01) |
| C 09 K 3/00 | (2006.01) |
| C 07 D 307/46 | (2006.01) |
| C 07 D 333/22 | (2006.01) |
| C 07 B 61/00 | (2006.01) |

【F I】

| | |
|---------------|-------|
| C 07 C 381/12 | C S P |
| C 07 F 5/02 | A |
| C 09 K 3/00 | K |
| C 07 D 307/46 | |
| C 07 D 333/22 | |
| C 07 B 61/00 | 3 0 0 |

【誤訳訂正書】

【提出日】平成25年11月29日(2013.11.29)

【誤訳訂正1】

【訂正対象書類名】特許請求の範囲

【訂正対象項目名】請求項9

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【請求項9】

着色表面コーティング及び非着色表面コーティング、接着剤、積層接着剤、構造用接着剤、感圧接着剤、印刷インク、印刷版、凸版印刷版、平版印刷版、凹版印刷版、無処理印刷版、スクリーン印刷ステンシル、歯科組成物、カラーフィルタ、スペーサ、エレクトロルミネセンスディスプレイ及び液晶ディスプレイ(LCD)、導波管、光スイッチ、色校正刷系、レジスト、電子工学用フォトレジスト、電気メッキレジスト、液膜及び乾燥膜の両方のためのエッチングレジスト、ソルダレジスト、UV及び可視レーザ直接結像系用フォトレジスト材料、プリント回路基板の連続ビルドアップ層における誘電層の形成用フォトレジスト材料、カラーフィルタ、化学增幅レジスト材料、画像記録材料、ホログラフィック画像の記録用画像記録材料、光学情報ストレージ又はホログラフィックデータストレージ、脱色材料、画像記録材料用脱色材料、マイクロカプセルを使用する画像記録材料、磁気記録材料、マイクロ機械部品、メッキマスク、エッチマスク、ガラス纖維ケーブルコーティング、超小形電子回路の製造における放射線感受性酸供与体としての請求項1に記載の式Iの化合物の使用。

【誤訳訂正2】

【訂正対象書類名】特許請求の範囲

【訂正対象項目名】請求項13

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【請求項13】

着色表面コーティング及び非着色表面コーティング、接着剤、積層接着剤、構造用接着剤、感圧接着剤、印刷インク、印刷版、凸版印刷版、平版印刷版、凹版印刷版、無処理印刷版、スクリーン印刷ステンシル、歯科組成物、カラーフィルタ、スペーサ、エレクトロルミネセンスディスプレイ及び液晶ディスプレイ（LCD）、導波管、光スイッチ、色校正刷系、レジスト、電子工学用フォトレジスト、電気メッキレジスト、液膜及び乾燥膜の両方のためのエッチングレジスト、ソルダレジスト、UV及び可視レーザ直接結像系用フォトレジスト材料、プリント回路基板の連続ビルドアップ層における誘電層の形成用フォトレジスト材料、カラーフィルタ、化学增幅レジスト材料、画像記録材料、ホログラフィック画像の記録用画像記録材料、光学情報ストレージ又はホログラフィックデータストレージ、脱色材料、画像記録材料用脱色材料、マイクロカプセルを使用する画像記録材料、磁気記録材料、マイクロ機械部品、メッキマスク、エッチマスク、ガラス纖維ケーブルコーティング、超小形電子回路の製造における請求項11又は12に記載の方法。

【誤訳訂正3】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0386

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0386】

また、本発明は、着色表面コーティング及び非着色表面コーティング、接着剤、積層接着剤、構造用接着剤、感圧接着剤、印刷インク、印刷版、凸版印刷版、平版印刷版、凹版印刷版、無処理印刷版、スクリーン印刷ステンシル、歯科組成物、カラーフィルタ、スペーサ、エレクトロルミネセンスディスプレイ及び液晶ディスプレイ（LCD）、導波管、光スイッチ、色校正刷系、レジスト、電子工学用フォトレジスト、電気メッキレジスト、液膜及び乾燥膜の両方のためのエッチングレジスト、ソルダレジスト、UV及び可視レーザ直接結像系用フォトレジスト材料、プリント回路基板の連続ビルドアップ層における誘電層の形成用フォトレジスト材料、カラーフィルタ、化学增幅レジスト材料、画像記録材料、ホログラフィック画像の記録用画像記録材料、光学情報ストレージ又はホログラフィックデータストレージ、脱色材料、画像記録材料用脱色材料、マイクロカプセルを使用する画像記録材料、磁気記録材料、マイクロ機械部品、メッキマスク、エッチマスク、ガラス纖維ケーブルコーティング、超小形電子回路の製造における感光性酸供与体としての式Iの化合物の使用と；並びに、着色表面コーティング及び非着色表面コーティング、接着剤、積層接着剤、構造用接着剤、感圧接着剤、印刷インク、印刷版、凸版印刷版、平版印刷版、凹版印刷版、無処理印刷版、スクリーン印刷ステンシル、歯科組成物、カラーフィルタ、スペーサ、エレクトロルミネセンスディスプレイ及び液晶ディスプレイ（LCD）、導波管、光スイッチ、色校正刷系、レジスト、電子工学用フォトレジスト、電気メッキレジスト、液膜及び乾燥膜の両方のためのエッチングレジスト、ソルダレジスト、UV及び可視レーザ直接結像系用フォトレジスト材料、プリント回路基板の連続ビルドアップ層における誘電層の形成用フォトレジスト材料、カラーフィルタ、化学增幅レジスト材料、画像記録材料、ホログラフィック画像の記録用画像記録材料、光学情報ストレージ又はホログラフィックデータストレージ、脱色材料、画像記録材料用脱色材料、マイクロカプセルを使用する画像記録材料、磁気記録材料、マイクロ機械部品、メッキマスク、エッチマスク、ガラス纖維ケーブルコーティング、超小形電子回路の製造のための製造方法と、に関する。